

日光協ニュース

No.303/304

2025年11月/12月

日本光学工業協会

本年11月、12月の合併号としてお届け致します。

ISO/TC172/SC1 及び SC1/WG1, WG2, WG3 国際 Virtual 会議

令和7年9月29日(月)～10月16日(木)の期間で、ISO/TC172/SC1、同WG1、WG2、WG3、関連するSC3/WG1合同の国際Virtual会議が開催されました。スケジュールは、下記をご参照ください。

ISO/TC 172/SC 1 Preliminary Meeting Schedule 2025		
DATE	MEETING	TIME
29 September (Mon)	SC 1 - 1 st Plenary	UTC 12.00
01 October (Wed)	SC 1/WG 1+WG 2	UTC 12.00
07 October (Tue)	SC 1/WG 1	UTC 12.00
08 October (Wed)	SC 1/WG 1 + SC 3/WG 1	UTC 12.00
14 October (Tue)	SC 1/WG 3	UTC 12.00
15 October (Wed)	SC 1/WG 2	UTC 12.00
16 October (Thu)	SC 1 – 2 nd Plenary	UTC 12.00

日本からは、ISO/TC172/SC1 金山谷分科会長、WG1 平井主査、WG2 佐藤主査、WG3 村田主査、事務局上田が出席いたしました。

下記に、金山谷分科会長の報告書の抜粋を添付いたします。

2025 年の TC172/SC1 の国際会議は、Virtual にて 2025/09/29 から 10/16 の間の 7 日、WG1、WG2、WG1+WG2 合同、WG3 に加え、SC1/WG1+ SC3/WG1、および SC1 Plenary Meeting が開催された。Plenary meeting の内容を中心に報告する。

1. 概要

Plenary Meeting では P メンバーは、SC1 議長の米国を含めて 13 カ国（ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ナイジェリア、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国）だが、今回の Plenary meeting への参加はドイツ、インド、日本、ルーマニア、英国、米国、中国の計 7 カ国。初日の 1st Plenary では、行動規範の確認後 Secretary report として ISO/TC172/SC1 の現状、この一年の活動内容、ISO 指令更新内容等が SC1 の committee manager の Anna Perbiless から報告され、最終日の 2nd Plenary では各 WG の Recommendation からの Resolution 決議へと進めた。また来年の日本開催の国際会議については 2025/11 月開催まで決定。SC3 と共同ということで、SC1 では具体的な話は行わらず後日 Update となった。

尚、今回 Virtual の国際会議ということもあり、事前に各 WG で Recommendation 相当の議論が事前に行われていたため、概ね国際会議開催期間で時間内に議論を完了することができた。

2. SC1 Plenary Meeting 内容

1) 出席メンバー

- i. 日本からの出席者(敬称略)は、上田(日本光学工業協会)、平井(キヤノン)、佐藤(オリンパス)、金山谷(ニコン)
- ii. 他国含めた出席者は以下(2nd Plenary)

NSB (Country) / Role	Name	Attendance Plenary
Chair and Convenor ISO/TC 172/SC 1/WG 2	Youngworth, Richie	X
Committee Manager	Perbiless, Anna	X
ANSI (United States)		
Head of Delegation	Herman, Eric	X
	Michels, Jennifer	X
DIN (Germany)		
Head of Delegation	Jahn, Dirk	X
Convenor ISO/TC 172/SC 1/WG 1	Kiehaber, Daniel	X
	Frick, Rainer	X
	Goletz, Torsten	X
	Knell, Holger	X
	Pfeffer, Michael	X
	Schake, Markus	X
	Thomae, Manfred	X
JISC (Japan)		

JISC (Japan)		
Head of Delegation	Kanayamaya, Nobumichi	X
	Sato, Yosuke	X
	Hirai, Shinichirou	X
	Ueta, Soichi	X
ASRO (Romania)		
Head of Delegation	Granciu, Dana	X
SNV (Switzerland)		
Head of Delegation	Langenbach, Eckhard	X
BSI (United Kingdom)		
Head of Delegation	MacKay, Peter	X

2) 討議および決定内容

i. 1st Plenary (2025/09/29)

① 2025 年 SC1 Report (CM: Anna Perbliess)

1. 構成

- ① Committee Manager: Anna Perbliess (ドイツ) ← 新任
- ② Chair (until 2025): Richard Youngworth (米国)
- ③ WG1 (General optical test methods) Convener: Daniel Kiehaber (ドイツ、2026/末まで)
- ④ WG2 (Preparation of drawings for optical elements and systems) Convener: Richard Youngworth (米国、2025/末まで)
- ⑤ WG3 (Environmental test methods) Convener: Michel Honlet (ドイツ、2026/末まで)

2. 参加国

- ① Participating countries (13): ナイジェリアが O メンバーから P メンバーに復帰
 - ・ ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ルーマニア、ロシア、イスラエル、英國、米国、ナイジェリア
- ② Observing countries (12) :
 - ・ オーストリア、ブルガリア、チェコ、イラン、ニュージーランド、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スペイン

3. リエゾン (SC1 側)

- ① TC10/SC1 (Basic conventions): Anna Perbliess (ドイツ)
- ② TC10/SC6 (Mechanical engineering documentation): Anna Perbliess (ドイツ)、Mr Strobehn
- ③ TC 42 (Photography): Anna Perbliess (ドイツ)、Mr Herman
- ④ TC184/SC4 (Industrial data): Anna Perbliess (ドイツ)

- ⑤ TC213 (Dimensional and geometrical product specifications and verification): Anna Perbliess (ドイツ)、Paul E. Murphy(米国)
- ② 新規発行された ISO (2023/9-2024/10)
1. ISO 9335: Optics and photonics — Optical transfer function —Principles and procedures of measurement
 2. ISO 10110-6: Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 6: Centring and tilt tolerances
 3. ISO 10110-11: Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 11: Non-toleranced data
- ③ 現行中のプロジェクト
1. ISO/PWI 10110-1
 2. ISO/PWI 10110-9
 3. ISO/PWI 10110-18
 4. ISO/WD 9358
 5. ISO/DIS 14999-4
 6. ISO/DIS 10110-5
 7. ISO/FDIS 11421
- ④ 2026 年の Systematic review
1. SC1
 - ① ISO 25297-1:2012 Optics and photonics — Electronic exchange of optical data — Part 1: NODIF information mode
 - ② ISO 25297-2:2011 Optics and photonics — Electronic exchange of optical data — Part 2: Mapping to the classes and properties defined in ISO 23584 classes and properties defined in ISO 23584
 2. WG1&WG2
 - ① ISO 9336-1:2010
 - ② ISO 9039: 2008
 - ③ ISO 517: 2008
 - ④ ISO 10110-9:2016
 3. WG3
 - ① ISO 9022-1
 - ② ISO 9022-6
- ⑤ その他
1. 2016～2024 の resolution 残件確認
 - ① 複数案件があるが、ペンドティング等の内容のため今回で一度 Close 形式をとる。

ii. 2nd Plenary (2025/10/16)

① Resolution

1. WG1&WG2

① RESOLUTION 4 & 5/2025

- ISO/DIS 14999-4, ISO/DIS 10110-5 たくさんの検討、議論の末、FDIS へ進む合意がとれた。
- 細かい誤記等の指摘は 2025/11/17 まで。
- FDIS ドラフト完成予定 2025/12/15

2. WG1 (2025/10/07)

① RESOLUTION 6/2025

- ISO/WD 9358 CD を進める

② RESOLUTION 7/2025

- ISO 15529:2010 Confirm、次の SR は 5 年後

③ RESOLUTION 8/2025

- Open Resolution 13/2017 -Need for a metrology standard on diffractive surfaces

この Resolution を Close。回折面に関する計量標準の必要性を認識している。さらに、回折面の種類が多岐にわたることを踏まえると、複数の計量標準が必要となる可能性があることも認識している。ISO 17901 などの回折光学に関する ISO/TC 172/SC 9 の規格、特に SC 9/WG 7 の規格については、特に考慮する必要がある。Resolution 13/2017 は Close とし、この問題に対しては継続 Open とする。

3. WG3 (2025/10/14) Revise のみ記載

① RESOLUTION 9/2025

- ISO 9022-2:2015

② RESOLUTION 11/2025

- ISO 9022-7:2015

4. WG2 (2025/10/15)

① RESOLUTION 18/2025

- Convenor 再任 Richie Youn g worth 3 年延長

② RESOLUTION 20/2025

- ISO 10110-9/PWI Revise

③ RESOLUTION 22/2025

- ISO 10110-series and GPS usage

5. 2nd Plenary (2025/10/16)

① RESOLUTION 23/2025

- In the scope of SC 1 with a start date of 2026-04-15:

1. ISO 25297-1:2012, Optics and photonics — Electronic exchange of optical data — Part 1: NODIF information model

- 2. ISO 25297-2:2011, Optics and photonics — Electronic exchange of optical data — Part 2: Mapping to the classes and properties defined in ISO 23584
 - In the scope of WG 1 with a start date recommended by WG 1 of 2026-01-15:
 - 1. ISO 9336-1:2010, Optics and photonics — Optical transfer function — Application — Part 1: Interchangeable lenses for 35 mm still cameras
 - 2. ISO 9039:2008, Optics and photonics — Quality evaluation of optical systems — Determination of distortion
 - 3. ISO 517:2008, Photography — Apertures and related properties pertaining to photographic lenses — Designations and measurements
 - 4. ISO 15368, Optics and photonics — Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements
 - In the scope of WG 1 per Resolution 16/2024 with a start date of 2026-01-15:
 - 1. ISO/TR 14999-2, Optics and photonics — Interferometric measurement of optical elements and optical systems — Part 2: Measurement and evaluation techniques
 - In the scope of WG 2, provided a project has not been initiated, a start date of 2026-10-15 shall be initiated for:
 - 1. ISO 10110-9:2016, Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 9: Surface treatment and coating
 - In the scope of WG 3 with a start date recommended by WG 3 of 2026-01-15
 - 1. ISO 9022-1:2016, Optics and photonics — Environmental test methods — Part 1: Definitions, extent of testing
 - 2. ISO 9022-9:2016 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 9: Solar radiation and weathering
- ② RESOLUTION 24/2025
- 次回の国際会議は日本 2026/11 月

3) Plenary 報告

i. 1st Plenary

今年度の国際会議の議題確認及び過去の Resolution の残件確認を行った。

以前 WG4 で見ていた ISO 25297-1:2012、ISO 25297-2:2011 についても
隨時進捗確認していたが来年 S R。本件は日本が PL で進めていたことも
あり注視する必要がある。

ii. 2nd Plenary

- ① 基本各 WG で決めた Recommendation について報告があり、Zoom の挙
手機能を使い承認が進められた。
- ② 昨年と異なり、Recommendation に対して否決する国はなく滞りなく進
んだ。

4) その他

- i. 2025 年の国際会議は Web 開催ということもあり時間が制限されたため、特
に WG1 & WG2 合同開催の ISO 14999-4, ISO 10110-5 については国内で
の議論を十分行い、開催前に PL の Paul 氏に事前に日本のコメントと詳細
説明を行うことで PL と事前に合意ができ円滑に議論ができた。各主査及
び担当いただいた国内委員には感謝いたします。
- ii. WG2 主査上田氏が国際会議直前で都合により、WG1 の佐藤委員に WG2 主
査になってもらい進めていただいた。短い時間での準備、対応となつたが
滞りなく進み、国際的な対応としては十分に成果があった。
- iii. ISO 10110 シリーズに GPS をどの程度対応するかの議論は全部適用しない
合意はできたが、今後どの程度適用するかは継続議論する必要がある。始
めに ISO 10110-1 のドラフトから議論になると思われる。

以上

令和 7 年度後期技能検定の準備作業終了

令和 7 年 11 月 7 日(金)に、港区芝公園の機械振興会館会議室において、令和 7 年度後期技能検定「光学機器組み立て作業」の実技試験で使用する器材の点検が行われました。この日は、関連各社（オリンパス(株)、キヤノン(株)、(株)トプコン、(株)ニコン、ギガフォトン(株)）より推薦された 6 名の技能検定委員の方々により、ガラス部品・備品・副資材等を中心に入念な点検が行われました。

令和 7 年度後期技能検定 首席・事務局会議開催及び実技試験実施について

令和 7 年 11 月 28 日(金)午前、千代田区飯田橋 工業教育会館会議室にて、令和 7 年度後期技能検定 首席技能検定委員・事務局会議が開催されました。当協会からは、安藤首席技能検定委員及び事務局長が出席いたしました。

会議では、冒頭委嘱状の交付が東京都職業能力開発協会より行われ、その後技能検定試験に関する様々な注意事項の説明が行われました。

同日の午後、港区芝公園の機械振興会館会議室において、水準調整会議が開催されました。技能検定関連各社（オリンパス(株)、キヤノン(株)、(株)トプコン、(株)ニコン、ギガフォトン(株)）の事務局及び技能検定委員が参加しました。

また、今年度の東京都における「光学機器組立て作業の実技試験」は、12 月 6 日(土)、7 日(日)、14 日(日)、20 日(土)の 4 日間に実施されました。1 級 19 人、2 級 27 人、合計 46 人の方が受験しました。

JIS 原案作成委員会

JIS 原案作成公募制度 2025 区分 B に応募し、第 3 回 JIS 原案作成委員会を開催いたしました。以下、進捗と議事内容より抜粋です。

対象規格

JIS B7156：ライフルスコープー仕様
JIS B7263-3：望遠鏡試験方法－第 3 部：ライフルスコープ

- ・2025 年 9 月 17 日(水)に開催した第 2 回 JIS 原案作成委員会の審議結果より原案と解説案を作成済み。
- ・国際委員会では JIS B 7156 の対応国際規格である ISO 14135-1 と ISO 14135-2 を統合した改訂が進められており、11 月段階で ISO/CD 14135 の投票が終了しコメントに対応した修正を行っている。従来の JIS 原案作成委員会の報告書提出期限までにさらなる内容の変更が予想されることから、DIS 登録以降の内容を JIS に反映していく。また、JIS B 7263-3 についても、基となる ISO 14490-3 が ISO 14135 に関連しているため、併せて報告書提出を延期する。
- ・JIS 原案作成委員会の活動については、ISO/DIS 14135 の審議状況に応じて、別途連絡する。

対象規格

JIS B0090-18：光学素子及び光学システム用の製図手法－第 18 部:応力複屈折、泡及び異物、均一性並びに脈理

開催日時：2025 年 11 月 26 日(水) 13:30～16:30

場 所：機械振興会館 B3 階 B3-7 会議室、Web 会議併用

出席委員：室谷委員長、渋谷委員、伊藤委員、西村委員、上窪委員、

佐藤委員、内山委員、金山谷委員

関係者： 青山様（経済産業省）、唐井様（経済産業省）

オブザーバー：若松様

事務局：上田

主な審議確認事項

- ・佐藤委員より第 2 回審議でのコメントシートと JIS B0090-18 修正案、解説案を説明し、審議した。
- ・第 3 回委員会の審議コメント、本文修正案、解説修正案を作成し、委員にチェックを依頼済み。チェックコメントの内容より第 4 回委員会の開催を判断する。

年末年始における年次有給休暇取得促進の御協力について（御依頼）

雇均総発 1014 第 1 号 令和 7 年 10 月 14 日

厚生労働省雇用環境・均等局総務課長より、当協会会長宛に協力依頼を受領しました。以下に抜粋を記します。

厚生労働行政の運営につきましては、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、年次有給休暇の取得率につきましては、令和 5 年に 65.3% と、前年より 3.2 ポイント上昇し、過去最高を更新したものの、政府目標である 70% とはいまだ乖離があります。

このため、厚生労働省では、10 月の「年次有給休暇取得促進期間」に続き、この年末年始における年次有給休暇の取得促進の機運を醸成するための取組を行うこととしました。

具体的には、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度（※1）や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度（※2）の活用を含め、年次有給休暇を積極的に取得いただくことにより働き方・休み方の見直しを促すポスター及びリーフレットを作成し、これらを用いた広報や労使への働きかけ等を行うこととしております。

つきましては、貴職におかれても、本取組の趣旨を御理解いただき、同封のポスターの掲示やリーフレットの配布、広報誌への掲載等により、傘下企業等への周知に御協力いただきますようお願いいたします。

なお、リーフレットについては、以下サイトにも掲載しておりますので併せてご利用ください。

○年次有給休暇取得促進特設サイト

<https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/>

（※1）年次有給休暇の付与日数のうち 5 日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

（※2）年次有給休暇の付与は原則 1 日単位ですが、労使協定を締結すれば、年 5 日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。（分単位など時間未満の単位での取得は認められません。）

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

厚生労働大臣 福岡資磨 令和7年10月16日

厚生労働大臣より、標記の件に関する連絡がございました。以下に抜粋を記します。

日頃より、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。

過労死等防止対策推進法（平成26年法律第100号）では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされており、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（令和6年8月2日閣議決定）では、過労死等防止対策の数値目標として、週労働時間40時間以上の雇用者のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする（令和10年まで）、年次有給休暇の取得率を70%以上とする（令和10年まで）等が掲げられています。

こうした中で、過労死等の労災支給決定件数は近年増加傾向にあり、また、令和6年4月からは、建設の事業、自動車運転の業務、医師等についても、時間外労働の上限規制が適用されています。

このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めて過重労働解消キャンペーンの趣旨を御理解いただき、次の事項が着実に取り組まれるよう、傘下団体・企業等に対する周知啓発について御協力をいただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

1 労働時間を適切に管理することに加え、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図ることで時間外労働の削減に取り組むとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくこと

（具体的な取組例）

- ・経営トップによるメッセージの発信
- ・勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制度、時間単位の年次有給休暇制度等の導入
- ・ノー残業デーの設定
- ・年次有給休暇の取得による連休の実現（プラスワン休暇）等

2 令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用された建設の事業、自動車運転の業務については、長時間労働の背景として、取引慣行上の課題が挙げられるこ

とから、

(1) 建設工事の発注者となる場合には、週休 2 日を確保することに配慮した適正な工期設定となるよう考慮すること

(2) 荷主となる場合には、長時間の恒常的な荷待ちを発生させない取組等を行っていただくこと

(具体的な取組例)

- ・入庫時刻の予約など荷物の積み下ろしに関する予約受付システムの導入
- ・パレット等の活用
- ・十分な納品リードタイムの確保
- ・運送を考慮した出荷時刻の設定等

3 自社の働き方改革等により、取引先中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うこと

また、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう取り組んでいただくこと

4 令和 5 年 4 月 1 日からの、中小企業における月 60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げへの対応も含め、時間外労働に対する割増賃金を適正に支払っていただくこと

改正労働安全衛生法説明会の開催に伴う協力依頼について

令和 7 年 11 月 7 日

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課より、標記の件に関する連絡がございました。以下に抜粋を記します。

労働安全衛生対策の推進につきましては、平素から格別のご協力を賜り深く感謝申し上げます。

厚生労働省におきましては、個人事業者等を含む多様な就業形態における安全衛生対策の一層の推進を図る目的とする「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」の施行に向け、全国 13 都市およびオンラインにて説明会を開催する運びとなりました。

つきましては、説明会の趣旨をご理解いただき、関係機関及び傘下の団体等に対する周知等格段のご協力を賜れますよう、よろしくお願ひ申し上げます。説明会の参加は、下記 URL または二次元コードより、事前の参加申込をお願いします。

https://mhlw-anzen-eisei-r7.peatix.com/events/?utm_source=letter

公正な採用選考システムの確立を図るためご協力依頼

令和 7 年 11 月

厚生労働省職業安定局雇用開発企画課就労支援室長より、標記の件に関する連絡がございました。以下に抜粋を記します。

時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃から職業安定行政の推進につきましては、格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省におきましては、各企業に公正採用選考人権啓発推進員を選任していただきなど、公正な採用選考システムの確立に向けた取組みをお願いしているところであります。

また、平成 28 年 12 月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」に基づき、出身地による就職差別の解消を目的として、本人の適性と能力に基づく公正な採用選考の取組の啓発を一層推進していく所存でございます。

このたび、企業啓発の一環として、公正採用選考啓発ポスターを作成いたしましたので、企業内での公正な採用選考についての意識共有及び公正採用選考人権啓発推進員の選任等が適切に行われますよう、掲示や配布等いただきたく送付申し上げます。

今後とも、公正な採用選考システムの確立を図るために一層の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

詳細は公正採用選考特設サイトからご確認ください。

<https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/>

第 2 回化学物質管理強調月間の実施に伴う協力依頼について

厚生労働省発基安 1104 第 2 号 令和 7 年 11 月 4 日

厚生労働省事務次官より、当協会会長宛に協力依頼を受領しました。以下に抜粋を記します。

化学物質による労働災害の防止につきましては、平素から格別の御協力を賜わり深く感謝申し上げます。

厚生労働省におきましては、産業界における自律的な化学物質管理活動を推進するとともに、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るため、このたび化学物質管理強調月間を創設し、主唱しております。

別添の「第2回化学物質管理強調月間実施要綱」に基づき、令和8年2月1日から2月28日までを化学物質管理強調月間として、

「慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方」

をスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うこととしました。

つきましては、この強調月間の趣旨を御理解いただき、関係機関及び傘下の団体等に対する周知等格段の御協力を賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

令和8年経済センサス・活動調査の事前周知について（依頼）

総統令第90号 令和7年12月10日

総務省統計局長より、当協会会長宛に協力依頼を受領しました。以下に抜粋を記します。

日頃より政府が実施する各種統計調査に御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

総務省及び経済産業省では、令和8年6月に、全ての事業所・企業を対象とした令和8年経済センサス・活動調査（以下「本調査」という。）を実施いたします。

本調査は、全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の実施のための母集団情報を整備することを目的とする政府の重要な調査であり、統計法（平成19年法律第53号）に基づいた報告義務のある調査（基幹統計調査）として5年に一度実施しています。

つきましては、本調査のより円滑な実施に向け、その趣旨や必要性など、貴団体に属する企業等の皆様へ広く御周知いただきますようお願い申し上げます。

なお、本調査は、企業だけでなく全ての団体の皆様も対象となりますので、令和8年4月頃に調査票が配布されましたら御回答をいただきますよう、併せてお願い申し上げます。

詳しくは、経済センサス・活動調査キャンペーンサイトを御高覧ください。

経済センサス・活動調査キャンペーンサイト <https://www.e-census2026.go.jp>

関係団体情報

一般社団法人 日本オプトメカトロニクス協会セミナー案内

「光学実験入門」技術講座

幾何学などで、物体と像との関係を調べたり、できた像の大きさなどを求めたりしますが、本講座では実際に凸レンズや凹レンズを用いて光学ベンチ上に組み上げ、その動向が計算結果と合致するかを確認しながら行っています。レンズには収差が発生することは避けられませんが、球面収差や軸上の色収差を実験でその量を計測して、同時に収差量を計算した結果と比較して理解を深めます。また、ルーペ、プロジェクター、レンズメータ、望遠鏡、顕微鏡、ズームレンズなどの光学系を光学ベンチ上に実際に作り各レンズの役割を実験でデータを取りながら確認していきます。

本講座では参加される方々に実際にレンズに触れ、光学系を組み上げて像を作って頂きます。そして、その時の像の状態やレンズ間隔などを計測してデータ表に記入していただきます。同時に理論上の計算などを行い実験結果のデータと比較して、その違いなどを考察していきます。更に、レンズで像を作るためには、光軸が合致している事が必要不可欠であることなどを、実験を通じて理解を深めていただければと期待しております。

開催日：2026年2月19日（木）10時～17時30分, 20日（金）9時-15時15分

会 場：機械振興会館 別館4階 当協会研修室

講 師：齋藤 晴司 氏

（元株式会社ニコン ビジネススタッフセンター人事部能力開発室 主幹）

プログラム：

<1日目>

- 1.ピンホールカメラの実験 2.レンズの焦点距離の計測実験
- 3.レンズによる結像実験 4.レンズの収差測定の実験 5.ルーペの実験

<2日目>

- 6.スライドプロジェクターの実験 7.レンズメータの実験 8.望遠鏡の実験
- 9.顕微鏡の実験 10.組合せレンズの実験

※関数付電卓と定規をご持参ください。

2025年9月生産・出荷累計統計

	生産		受入	出荷			月末在庫		
	数量	金額 (百万円)		販売		その他			
				数量	金額 (百万円)				
デジタルカメラ	232,299 (0.95)	10,746 (0.76)	383,813 (0.92)	209,231 (0.82)	18,722 (0.90)	383,622 (0.92)	259,698 (1.03)		
カメラ	7,384 (1.02)	10,514 (1.16)	6,041 (0.94)	6,544 (0.90)	10,561 (1.04)	6,388 (1.03)	14,379 (1.04)		
交換レンズ	171,740 (1.08)	12,522 (1.27)	388,073 (0.71)	359,559 (0.88)	25,274 (1.10)	233,808 (0.71)	1,014,875 (0.99)		
光学・精密測定機	20,299 (1.15)	6,541 (1.12)	—	23,040 (0.74)	7,446 (0.95)	—	100,480 (1.11)		
光分析機器	8,757 (0.61)	12,342 (0.42)	—	9,235 (0.67)	15,393 (0.50)	—	24,670 (1.04)		
測量機	2,077 (0.92)	673 (1.08)	—	9,385 (0.86)	1,921 (1.06)	—	7,192 (0.96)		
合計	—	53,338 (0.78)	—	—	79,317 (0.84)	—	—		

() 内は、前年比

注) 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

- (イ) 他企業から購入したもの(輸入を含む)
- (ロ) 同一企業内の他工場から受入れたもの
- (ハ) 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの
- (ニ) 返品(戻入れ)されたもの

令和7年12月29日発行

日本光学工業協会

〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館204号室

電話・ファックス: 03-3431-7073

<https://www.e-joia.jp> e-mail: joia.office@e-joia.jp

発行人 牛田一雄

編集 上田壮一(事務局)